

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成18年12月21日(2006.12.21)

【公表番号】特表2006-504831(P2006-504831A)

【公表日】平成18年2月9日(2006.2.9)

【年通号数】公開・登録公報2006-006

【出願番号】特願2004-548798(P2004-548798)

【国際特許分類】

C 08 L 101/00 (2006.01)

C 08 K 5/02 (2006.01)

C 08 K 5/3492 (2006.01)

C 08 K 5/52 (2006.01)

【F I】

C 08 L 101/00

C 08 K 5/02

C 08 K 5/3492

C 08 K 5/52

【手続補正書】

【提出日】平成18年10月30日(2006.10.30)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

(a) 有機ポリマー基材、及び

(b) (i) 少なくとも1種のメラミンベースの難燃剤、及び

(ii) 有機ハロゲン難燃剤及びリン含有難燃剤からなる群から選択される少なくとも1種の難燃剤

の混合物の有効難燃化量

を含む難燃性ポリマー組成物。

【請求項2】

前記成分(b)のメラミンベースの難燃剤が、メラミンシアヌレート、メラミンボレート、メラミンホスフェート、メラミンポリホスフェート、メラミンピロホスフェート、メラミンアンモニウムポリホスフェート及びメラミンアンモニウムピロホスフェートからなる群から選択される請求項1記載の組成物。

【請求項3】

前記有機ハロゲン難燃剤(ii)が、ポリ臭素化ジフェニルオキシド、デカブロモジフェニルオキシド、トリス[3-ブロモ-2,2-ビス(ブロモメチル)ブロピル]ホスフェート、トリス(2,3-ジブロモブロピル)ホスフェート、テトラブロモフタル酸、テトラブロモビスフェノールAのビス(2,3-ジブロモブロピルエーテル)、臭素化工ボキシ樹脂、エチレン-ビス(テトラブロモフタルイミド)、オクタブロモジフェニルエーテル、1,2-ビス(トリブロモフェノキシ)エタン、テトラブロモ-ビスフェノールA、エチレンビス-(ジブロモ-ノルボルナンジカルボキシミド)、トリス-(2,3-ジブロモブロピル)-イソシアヌレート及びエチレン-ビス-テトラブロモフタルイミドからなる群から選択される有機臭素系難燃剤である請求項1記載の組成物。

【請求項4】

前記リン含有難燃剤(i i)が、クロロアルキルホスフェートエステル、トリス(2 - クロロエチル) ホスフェート、ポリ臭素化ジフェニルオキシド、デカブロモジフェニルオキシド、トリス[3 - ブロモ - 2 , 2 - ビス(ブロモメチル) プロピル] ホスフェート、トリス(2 , 3 - ジブロモプロピル) ホスフェート、トリス(2 , 3 - ジクロロプロピル) ホスフェート、クロレンド酸、テトラクロロフタル酸、テトラブロモフタル酸、ビス - (N , N ' - ヒドロキシエチル) テトラクロルフェニレンジアミン、ポリ - - クロロエチルトリホスホネート混合物、テトラブロモビスフェノールAのビス(2 , 3 - ジブロモプロピルエーテル)、臭素化工ポキシ樹脂、エチレン - ビス(テトラブロモフタルイミド)、ビス(ヘキサクロロシクロペントジエノ) シクロオクタン、塩素化パラフィン、オクタブロモジフェニルエーテル、ヘキサクロロシクロペントジエン誘導体、1 , 2 - ビス(トリブロモフェノキシ) エタン、テトラブロモ - ビスフェノールA、エチレン - ビス(ジブロモ - ノルボルナンジカルボキシミド)、ビス - (ヘキサクロロシクロペントジエノ) シクロオクタン、P T F E 、トリス - (2 , 3 - ジブロモプロピル) - イソシアヌレート、及びエチレン - ビス - テトラブロモフタルイミド、テトラフェニルレゾルシノールジホスフィット、トリフェニルホスフェート、トリオクチルホスフェート、トリクレシルホスフェート、テトラキス(ヒドロキシメチル) ホスホニウムスルフィド、ジエチル - N , N - ビス(2 - ヒドロキシエチル) - アミノメチルホスホネート、リン酸のヒドロキシアルキルエステル、ポリリン酸アンモニウム、レゾルシノールジホスフェートオリゴマー、ホスファゼン難燃剤、エチレンジアミンジホスフィット、ホスホネート及びそれらの金属塩及び、ホスフィネート及びそれらの金属塩からなる群から選択される請求項1記載の組成物。

【請求項5】

更に、

1 - シクロヘキシルオキシ - 2 , 2 , 6 , 6 - テトラメチル - 4 - オクタデシルアミノペリジン；

ビス(1 - オクチルオキシ - 2 , 2 , 6 , 6 - テトラメチルペリジニ - 4 - イル) セバケート；

2 , 4 - ビス[(1 - シクロヘキシルオキシ - 2 , 2 , 6 , 6 - テトラメチルペリジニ - 4 - イル) ブチルアミノ] - 6 - (2 - ヒドロキシエチルアミノ - s - トリアジン；

ビス(1 - シクロヘキシルオキシ - 2 , 2 , 6 , 6 - テトラメチルペリジニ - 4 - イル) アジペート；

2 , 4 - ビス[(1 - シクロヘキシルオキシ - 2 , 2 , 6 , 6 - テトラメチルペリジニ - 4 - イル) ブチルアミノ] - 6 - クロロ - s - トリアジン；

1 - (2 - ヒドロキシ - 2 - メチルプロポキシ) - 4 - ヒドロキシ - 2 , 2 , 6 , 6 - テトラメチルペリジン；

1 - (2 - ヒドロキシ - 2 - メチルプロポキシ) - 4 - オキソ - 2 , 2 , 6 , 6 - テトラメチルペリジン；

1 - (2 - ヒドロキシ - 2 - メチルプロポキシ) - 4 - オクタデカノイルオキシ - 2 , 2 , 6 , 6 - テトラメチルペリジン；

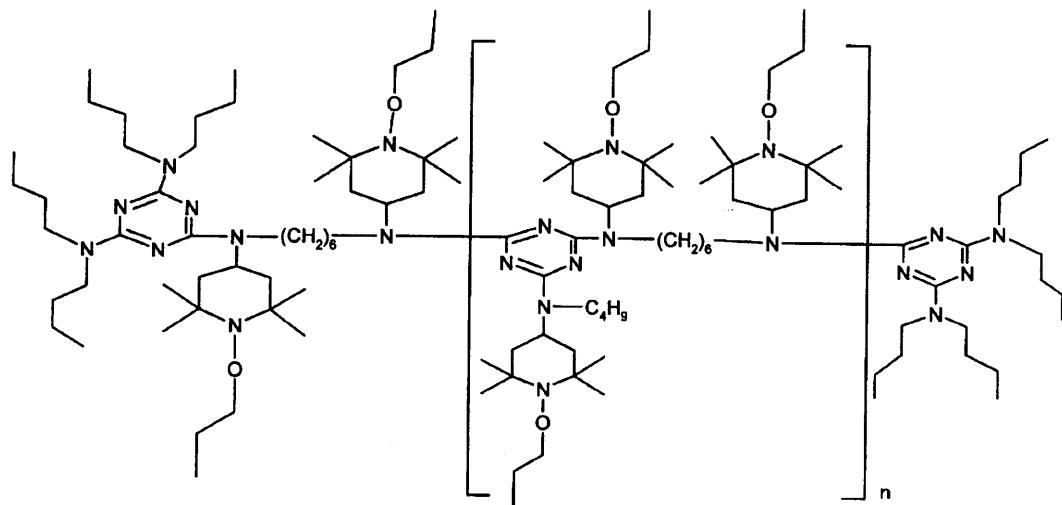
ビス(1 - (2 - ヒドロキシ - 2 - メチルプロポキシ) - 2 , 2 , 6 , 6 - テトラメチルペリジニ - 4 - イル) セバケート；

ビス(1 - (2 - ヒドロキシ - 2 - メチルプロポキシ) - 2 , 2 , 6 , 6 - テトラメチルペリジニ - 4 - イル) アジペート；

2 , 4 - ビス{ N - [1 - (2 - ヒドロキシ - 2 - メチルプロポキシ) - 2 , 2 , 6 , 6 - テトラメチルペリジニ - 4 - イル] - N - ブチルアミノ } - 6 - (2 - ヒドロキシエチルアミノ) - s - トリアジン、

2 , 4 - ビス[(1 - シクロヘキシルオキシ - 2 , 2 , 6 , 6 - テトラメチルペリジニ - 4 - イル) - ブチルアミノ] - 6 - クロロ - s - トリアジンと N , N ' - ビス(3 - アミノプロピル) エチレンジアミンの反応生成物及び式

【化1】



(式中、nは1ないし15を表わす。)で表わされる化合物

からなる群から選択される少なくとも1種の立体障害性アミン安定剤を含む請求項1記載の組成物。